

삼성전자, 중국 반도체 투자 확정

총 70억달러 투자 시안공장 건설 ... 2013년부터 낸드플래시 생산

삼성전자가 중국 산시(陝西)의 시안(西安)에 반도체 공장을 건설하기로 최종 확정했다.

삼성전자는 4월2일 이사회를 열어 시안 고신기술산업개발구역에 들어설 반도체 신규라인 건설을 위해 자본금 23억달러를 출자하기로 결정했다고 발표했다.

삼성전자는 건물 건설 등을 위해 23억달러를 출자한데 이어 앞으로 수년간 단계적으로 총 70억달러를 투자할 계획이다.

중국 투자는 삼성전자의 해외 반도체 생산라인 단일투자로는 역대 최대이다.

삼성전자가 중국 시안을 중국 진출지역으로 최종 선정한 것은 시안 주변에 삼성전자의 주요 수요처와 글로벌 IT(정보기술) 생산, 연구 거점이 밀집돼 있어 수요처의 요청에 신속하고 효율적으로 대응할 수 있고, 우수인재 유치에도 유리하다는 점이 가장 큰 요인으로 작용했다.

시안은 중국 정부가 야심차게 추진하고 있는 서부대개발 정책의 전략적 요충지로 전기, 용수 등 산업 인프라가 잘 갖추어져 있어 반도체 생산라인 건설에 최적의 장소로 평가되고 있다.

삼성전자는 중국과 생산과 고용 등 세부협상을 마무리하고 2012년 반도체 생산라인 건설에 착수해 2013년 말부터 10나노급 낸드플래시를 본격 생산할 예정이다. <저작권자 연합뉴스 - 무단전재·재배포 금지>

<화학저널 2012/04/03>